

Title (en)  
STRUCTURE FOR INFLUENCING THE EFFECT OF X-RAY OR GAMMA RADIATION ON A TARGET SENSITIVE TO THE RADIATION.

Title (de)  
STRUKTUR ZUR BEEINFLUSSUNG DES RÖNTGEN- ODER GAMMASTRAHLENEFFEKTS AUF EINEM STRAHLENEMPFFINDLICHEN ZIEL.

Title (fr)  
STRUCTURE UTILE POUR MODIFIER L'EFFET DE RAYONNEMENTS X OU GAMMA SUR UNE CIBLE SENSIBLE A CES RAYONNEMENTS.

Publication  
**EP 0400125 A1 19901205 (EN)**

Application  
**EP 89913115 A 19891128**

Priority  
HU 607588 A 19881128

Abstract (en)  
[origin: WO9006582A1] The present invention refers to a structure for influencing the effect of X-ray or gamma radiation on a target sensitive to the radiation (R), having a first and a second side, the X-ray or gamma radiation (R) striking the first side, the structure comprising at least one group of layers (1, 3, 5, 7) emitting a secondary radiation under the influence of the X-ray or gamma radiation (R) or the secondary radiation of layers (1, 3, 5, 7) arranged behind the first side in the way of propagation of the X-ray or gamma radiation (R). The essence of the invention lies comprising in the group at least a basic layer (1) and a second (3) layer arranged in a sequence of the atomic numbers of elements forming the layers (1, 3, 5, 7), wherein the basic layer is made of a metal selected from the group consisting of 28Pb, 74W and 73Ta, the second layer of a metal selected from the group consisting of 47Ag, 42Mo, 41Nb, 29Cu, 28Ni, 23V and 13Al.

Abstract (fr)  
Une structure utile pour modifier l'effet de rayonnements X ou gamme sur une cible sensible aux rayonnements (R) comprend des première et deuxième faces, les rayonnements X ou gamma (R) frappant la première face, au moins un groupe de couches (1, 3, 5, 7) qui émettent des rayonnements secondaires sous l'influence des rayonnements X ou gamma (R) ou de rayonnements secondaires émis par des couches (1, 3, 5, 7) agencées derrière la première face sur le trajet de propagation des rayonnements X ou gamma (R). Essentiellement, le groupe comprend au moins une couche de base (1) et une deuxième couche (3) agencées dans l'ordre des nombres atomiques des éléments dont se composent les couches (1, 3, 5, 7). La couche de base est composée d'un métal sélectionné dans le groupe formé de 28Pb, 74W et 73Ta et la deuxième couche est composée d'un métal sélectionné dans le groupe formé de 47Ag, 42Mo, 41Nb, 29Cu, 28Ni, 23V et 13Al.

IPC 1-7  
**G03C 5/17**; **G21F 1/12**

IPC 8 full level  
**G21F 3/00** (2006.01); **A61B 6/06** (2006.01); **G03B 42/02** (2006.01); **G03C 5/17** (2006.01); **G21F 1/12** (2006.01); **G21K 1/06** (2006.01); **G21K 1/10** (2006.01); **G21K 4/00** (2006.01); **H05G 1/02** (2006.01)

CPC (source: EP KR)  
**G21F 1/12** (2013.01 - KR); **G21F 1/125** (2013.01 - EP); **G21K 1/10** (2013.01 - EP)

Citation (search report)  
See references of WO 9006582A1

Designated contracting state (EPC)  
AT BE CH DE ES FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)  
**WO 9006582 A1 19900614**; AU 4633189 A 19900626; BR 8907213 A 19910305; EP 0400125 A1 19901205; JP H03502489 A 19910606; KR 900702537 A 19901207

DOCDB simple family (application)  
**HU 8900058 W 19891128**; AU 4633189 A 19891128; BR 8907213 A 19891128; EP 89913115 A 19891128; JP 50005989 A 19891128; KR 900701671 A 19900731